Semiconductor

半導体プロセスの理想形を トータルに創造する 先進の分析システム















差圧式

・サーマル式 マスフローモジュール マスフローモジュール SEC-Z700S **CRITERION D700**

ーキャパシタンス マノメータ

●液体材料 気化システム LF-F/MV-2000 **VG-500**

電極形成

ウエハ検査

プラズマ 発光モニタ **EV 2.0 Series**

●ガスモニタ IR-400

後工程

ウエハの

ダイシング

チップの

マウンティング

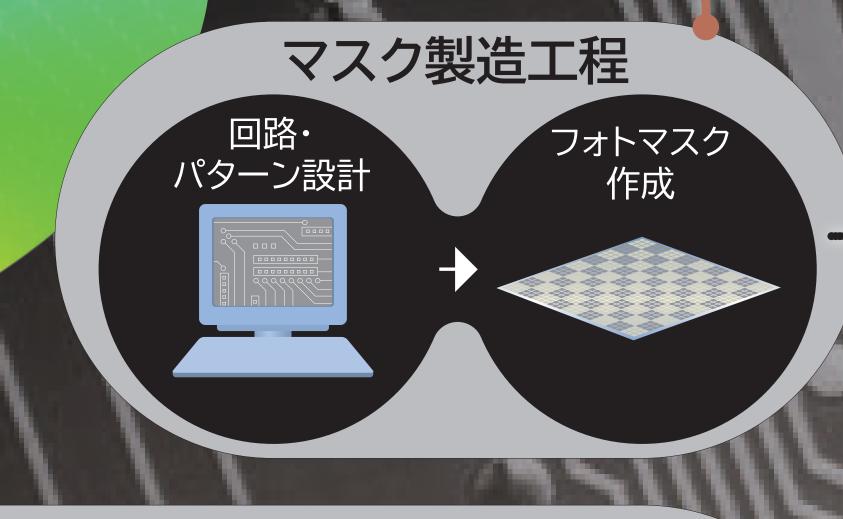
ワイヤーボンディング

モールド

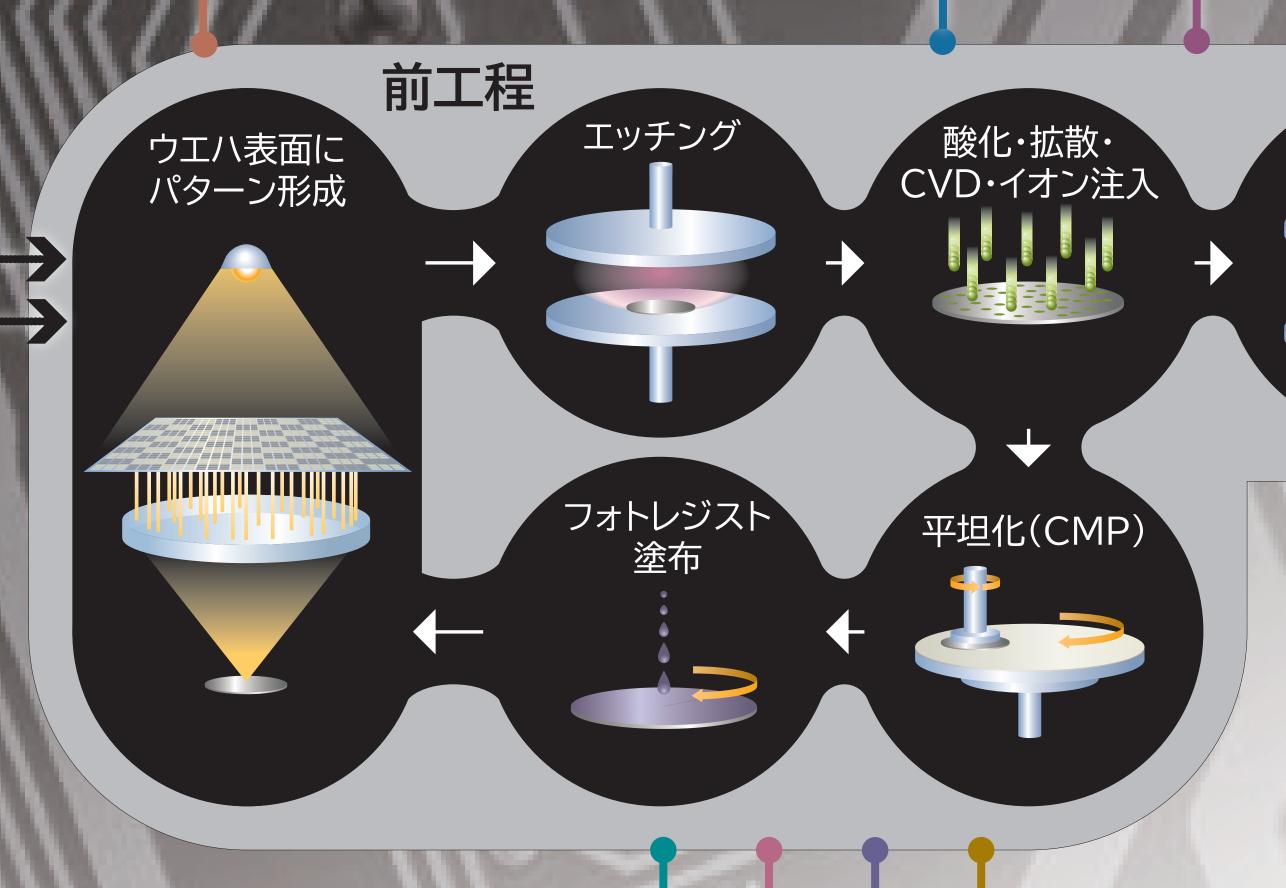
流体計測・制御 / 真空計測・分析(ドライプロセス)

●工業用pH計 排水分析

●自動薄膜計測装置●紫外可視エリプソメータ 計測/エッチング制御/薄膜分析



ウエハ製造工程 インゴット ウエハ表面 インゴットの ウエハの研磨 の引き上げ を酸化



- ●レーザ回折/散乱式粒子径 分布測定装置
- ●ナノ粒子解析装置

CMPプロセス

素材解析

- ●PL測定装置
- ●カソードルミネッセンス測定システム

クリーンルーム内雰囲気監視

●クリーンルーム内雰囲気ガスモニタ

素材解析(微粒子分析、欠陥解析)

- ●全自動薄膜検査装置
- ●顕微レーザラマン分光測定装置
- ●グロー放電発光分析装置 ●X線分析顕微鏡

純水プロセス(ウェットプロセス)

●高感度シリカモニタ

●シリカ分析装置

- ●溶存酸素モニタ
- ●超純水用比抵抗計



●全自動フォトルミネッセンス マッピング装置 PLATO-300

●非接触薬液濃度モニタ **CS-900**

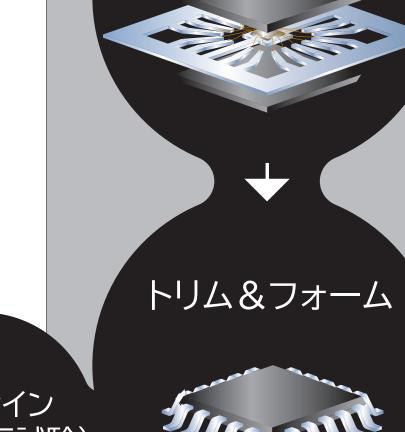


薬液プロセス(ウェットプロセス)

●光ファイバ式 熱リン酸濃度モニタ **CS-620F**



●内部液循環式 溶存酸素モニタ **HD-960LR**



HORIBA

株式会社堀場製作所 株式会社堀場エステック

〒601-8510 京都市南区吉祥院宮の東町2番地 TEL(075)-313-8121(代) http://www.horiba.co.jp 〒601-8116 京都市 南区上鳥羽鉾立町11-5

TEL(075)-693-2312

http://www.horiba-stec.jp

